

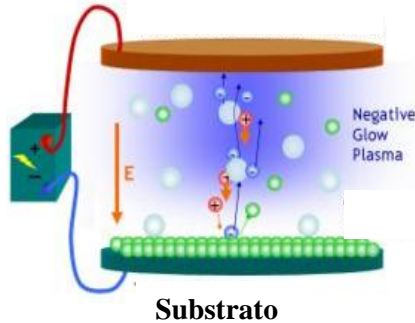


CENTRO DE NANOCIENCIAS Y MICRO Y NANOTECNOLOGÍAS

Ataque por iones reactivos (RIE)

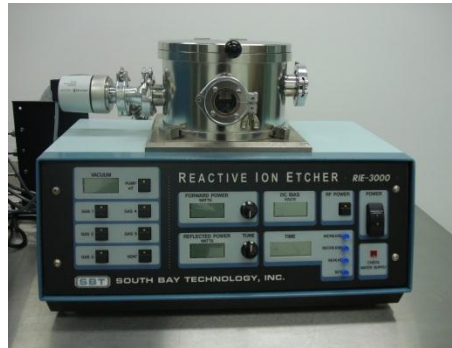
Descripción

El RIE es una técnica de ataque en seco que combina efectos físicos y químicos para remover materiales semiconductores así como materiales depositados en la superficie de los substratos mediante la generación de plasma a partir de gases.



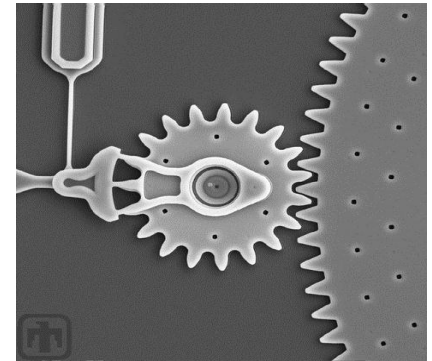
Aplicaciones

- Ataque o grabado de silicio.
- Ataque de dieléctricos como óxido de silicio (SiO_2) o nitruro de silicio (Si_3N_4).
- Ataque de polímeros como resinas fotosensibles entre otros.



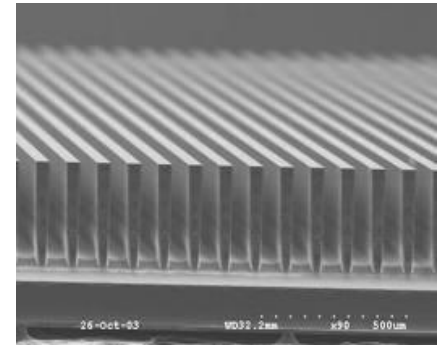
Resultados

- Maquinado para la fabricación de micro y nano sistemas electromecánicos.
- Desarrollo de microcanales.
- Obtención de micro-estructuras como cantiléver o membranas.



Beneficios

- Evita ataques isotrópicos.



Contacto

Dr. Jacobo Esteban Munguía Cervantes
jmunguia@ipn.mx
Tel. 57296000 Ext. 57513

